

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公開番号】特開 2001-125138 (P2001-125138A)

【公開日】平成 13 年 5 月 11 日 (2001.5.11)

【出願番号】特願 平 11-302778

【国際特許分類第 7 版】

G 0 2 F 1/1368

G 0 2 F 1/1333

G 0 2 F 1/1335

G 0 9 F 9/30

H 0 1 L 29/786

H 0 1 L 21/336

【F I】

G 0 2 F 1/136 5 0 0

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

G 0 2 F 1/1335 5 0 0

G 0 2 F 1/1335 5 1 0

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 4 9 B

H 0 1 L 29/78 6 1 2 B

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 5 月 27 日 (2004.5.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の基板上に剥離層を介して形成された薄膜デバイスを前記第 1 の基板から剥離して、第 2 の基板上に転写する工程 1 と、  
 前記薄膜デバイスを前記第 2 の基板から剥離して、第 3 の基板上に転写する工程 2 と、を有することを特徴とする薄膜デバイスの剥離方法。

【請求項 2】

請求項 1 に規定する薄膜デバイスの剥離方法を利用して製造されたアクティブマトリクス基板であって、

前記薄膜デバイスが、マトリクス状に配置された画素スイッチング用の薄膜トランジスタと、

当該トランジスタのゲートに電氣的に接続された走査線と、

当該トランジスタのソースに電氣的に接続されたデータ線と、

当該トランジスタのドレインに接続された画素電極と、

を備えたことを特徴とするアクティブマトリクス基板。

【請求項 3】

請求項 2 において、前記薄膜デバイスが、前記画素スイッチング用の薄膜トランジスタを駆動する駆動回路を備えたことを特徴とするアクティブマトリクス基板。

【請求項 4】

請求項 2 乃至 3 に記載のアクティブマトリクス基板を用いて製造された液晶表示装置であって、

前記第 3 の基板が偏光機能を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 5】

請求項 4 において、前記第 3 の基板が可曲性を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 6】

請求項 4 乃至 5 のいずれかにおいて、前記第 3 の基板が偏光機能を有するプラスチック基板であることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 7】

請求項 4 乃至 6 のいずれかにおいて、前記アクティブマトリクス基板がカラーフィルタを備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 8】

請求項 4 乃至 7 のいずれかにおいて、前記アクティブマトリクス基板がブラックマトリクスを備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 9】

請求項 7 乃至 8 のいずれかにおいて、前記工程 1 の後、前記カラーフィルタ及び／またはブラックマトリクスを、前記薄膜デバイスの裏面に形成することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 10】

請求項 4 乃至 9 のいずれかにおいて、液晶を介して前記アクティブマトリクスと対向する対向基板が、偏光機能を有し、共通透明電極を備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 11】

請求項 10 において、前記対向基板が可曲性を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 12】

請求項 10 乃至 11 のいずれかにおいて、前記対向基板が偏光機能を有し、共通透明電極を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 13】

請求項 10 において、前記対向基板がカラーフィルタを備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 14】

請求項 10 において、前記対向基板がブラックマトリクスを備えたことを特徴とする液晶表示装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0091】

次に、塗布されたレジスト層 600 に対して、フォトマスク 610 を介して露光を行い、画素領域に対応したレジスト層を感光させる。この際、マスクするパターンは、同色の画素領域のみが露光されるようにする。レジスト層 600 がポジ型のレジストであれば、露光された部分のみが感光し、これを現像すると露光されたレジスト層が除去され、マスクされた部分のみが残される。図 20 乃至 21 では、レジスト層 600 としてポジ型のレジストを用いた場合について示している。レジスト層としてネガ型のレジストを用いた場合には、マスクデータの正反を逆転させたフォトマスクを用いる。